

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

出願人代理人

志賀 正武

あて名

〒 104-0028

東京都中央区八重洲2丁目3番1号



PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）の
送付の通知書

（法施行規則第57条）

〔PCT規則71.1〕

発送日
（日.月.年）

06. 7. 2004

出願人又は代理人
の書類記号

PC-8929

重要な通知

国際出願番号

PCT/JPO3/12334

国際出願日

（日.月.年） 26. 09. 2003

優先日

（日.月.年） 30. 09. 2002

出願人（氏名又は名称）

凸版印刷株式会社

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告（付属書類を除く）の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に（官庁によってはもっと遅く）所定の手続（翻訳文の提出及び国内手数料の支払い）をしなければならない（PCT39条（1））（様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照）。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる（PCT第27条(5)も併せて参照）。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性及び裏付け要件を、特許要件から免除することを含む。

名称及びあて名

日本国特許庁（IPEA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

4G

3028

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

様式PCT/IPEA/416（2004年1月）

（添付用紙の注意書きを参照）

注 意

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館（特許庁庁舎2階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

〔担当及び照会先〕

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号（特許庁庁舎2階）

独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811～2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

〔申込方法〕

（1）特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

（2）公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

〔申込み及び照会先〕

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注） 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）

特 許 協 力 条 約

P C T

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 PC-8929	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/12334	国際出願日 (日.月.年) 26.09.2003	優先日 (日.月.年) 30.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ C23C16/505, C23C16/52, C23C16/42, C08J7/06		
出願人 (氏名又は名称) 凸版印刷株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☐ 附属書類は全部で _____ ページである。

☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)

☐ 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 08.03.2004	国際予備審査報告を作成した日 16.06.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 吉田 直裕	4G 3028
電話番号 03-3581-1101 内線 3416		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
☐ PCT規則12.4にいう国際公開
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に回答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 第 _____ 項*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ 項*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること) _____
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☒ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. ☐ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☐ 以下の理由により満足しない。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

- ☒ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 _____ に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	4-17	有 無
	請求の範囲	1-3	
進歩性 (IS)	請求の範囲	4, 12-17	有 無
	請求の範囲	1-3, 5-11	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-17	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

- 文献1 : JP 08-306685 A (シーメンス アクチエンゲゼルシャフト) 1996.11.22
 文献2 : JP 08-316214 A (松下電器産業株式会社) 1996.11.29
 文献3 : JP 2001-220679 A (凸版印刷株式会社) 2001.08.14
 文献4 : JP 11-181570 A (株式会社東芝) 1999.07.06
 文献5 : EP 0469926 A1 (THE BOC GROUP, INC.) 1992.02.05
 文献6 : EP 0299752 A2 (THE BOC GROUP, INC.) 1989.01.18
 文献7 : EP 0299754 A2 (THE BOC GROUP, INC.) 1989.01.18
 文献8 : JP 62-089869 A (住友電気工業株式会社) 1987.04.24
 文献9 : JP 62-093382 A (三菱電機株式会社) 1987.04.28

請求の範囲1-3

請求の範囲1-3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。

文献1の[0007]段落、実施例1には、オゾン含有ガスに対する初期のTEOSのガス流量比を約10%とし、引き続きオゾンに対するTEOSのガス流量比が小さい定常比に到達するまで、流量比を減少させることが記載されている。

請求の範囲4

請求の範囲4に記載された発明は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず新規性及び進歩性を有する。
 特に、請求の範囲4に記載された、供給流量比を連続的に減少させる第1成膜工程の後に、供給流量比を増加させる第2成膜工程を有する点は、文献1～文献4のいずれにも記載されておらず、当業者といえども、容易には想到し得ないことである。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

請求の範囲 5

請求の範囲 5 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1、2 から進歩性を有さない。

文献 2 の[0010]～[0011]段落等には、反射電力を低減するために、マッチング回路を設ける技術が記載されている。文献 1 に記載されたプラズマ CVD 装置においても、反射電力を低減するために、マッチング回路を設けること、そして、反射電力を投入電力の 10% 以下にすることは当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲 6－8

請求の範囲 6－8 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1、3 から進歩性を有さない。

文献 3 の特許請求の範囲の請求項 4 には、外部電極の内部に外部電極と接触するように絶縁体材料からなるスペーサーを設けることが記載されている。また、文献 3 の特許請求の範囲の請求項 9、10 には、内部電極の先端に直径 0.5 mm 以下の穴又は、短径が 0.5 mm 以下の長穴を設けることが記載されている。

以上より、文献 1 に記載された酸化珪素薄膜形成技術を、文献 3 に記載されたようなプラスチックボトル基材に適用する際に、文献 3 に記載された上記の構成を採用することは当業者が容易に想到し得ることである。

また、成膜チャンバを複数設けることは製造効率を考慮して当業者が適宜設計することに過ぎない。

請求の範囲 9－11

請求の範囲 9－11 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1、3、4 から進歩性を有さない。

文献 4 の[0010]～[0011]段落には、電極板の表面粗さにおける最大高さの値が 40～100 μm とすることによって、CVD による堆積層と電極板との密着性が大きくなり、CVD 工程中に堆積層の剥離によるダスト発生が低減されることが記載されている。

以上より、文献 1 に記載された酸化珪素薄膜形成技術を、文献 3 に記載されたようなプラスチックボトル基材に適用する際に、ダスト発生の低減を目的として、電極板の表面粗さを、文献 4 に記載されたような適切な値に設定することは当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲 12－17

請求の範囲 12－17 に記載された発明は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず新規性及び進歩性を有する。

特に、請求の範囲 12 に記載された水素アルファ線と酸素放射線との強度を比較する点は、文献 5～文献 9 のいずれにも記載されておらず、当業者といえども、容易には想到し得ないことである。